

- [3] Сагдеев Р.З. Физика плазмы и проблема управляемых термоядерных реакций, т. 3. М.: АН СССР, 1958. 346 с.
- [4] Геккер И.Р. Взаимодействие сильных электромагнитных полей с плазмой. М.: Атомиздат, 1978. 310 с.
- [5] Взаимодействие сильных электромагнитных полей с бесстолкновительной плазмой / Под ред. Литвака А.Г. Горький: ИПФ АН СССР, 1980. 200 с.
- [6] Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. М.: Атомиздат, 1979. 316 с.
- [7] Еремин Б.Г., Миллер М.А. // Изв. вузов. Радиофизика. Т. 5. С. 1151.
- [8] Гришин Л.В., Дорофеюк А.А., Коссый И.А. и др. // Тр. ФИАН. М.: Наука, 1977. Т. 92. С. 82.

Институт физики АН УССР,  
Киев

Поступило в Редакцию  
12 августа 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 17

12 сентября 1989 г.

#### 05.4

### ПЛЕНОЧНЫЙ СВЕРХПРОВОДНИКОВЫЙ КВАНТОВЫЙ ИНТЕРФЕРОМЕТР С РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 77 К

С.И. Бондаренко, А.В. Лукашенко,  
А.А. Шабло, С.В. Гапонов,  
Л.В. Малышева, П.А. Павлов,  
А.Ю. Чурин, Д.Г. Павельев

Проведенные к настоящему времени исследования квантовой интерференции в высокотемпературных керамиках связаны в основном с объемными массивными образцами [1–5] и только в работе [6] представлены по пленочным интерферометрам с рабочей температурой 68 К. Основной причиной такой ситуации являются технологические трудности, связанные как с созданием пленки с необходимыми критическими параметрами, так и с получением на пленке необходимой конфигурации интерферометра.

В настоящем сообщении представлены результаты исследования интерферометра, изготовленного на основе пленок  $Y_1Ba_2Cu_3O_{7-x}$ , полученных лазерным испарением на подложку  $SrTiO_3$ . Толщины пленок  $h \approx 500\text{--}1000 \text{ \AA}$ . Конфигурация и ВАХ образца при 77 К представлены на рис. 1. Диаметр отверстия в центре пленки равен  $d_o = 5 \text{ мкм}$ . Измерения проводились на постоянном токе по четырехзондовой методике. Критическая температура пленки  $T_c = 85 \text{ К}$ . Критическая плотность тока  $J_c(77 \text{ К}) = 0.8 \cdot 10^6 \text{ A/cm}^2$  возрастает с понижением температуры и при 4.2 К достигает величины  $J_c(4.2) = 0.7 \cdot 10^7 \text{ A/cm}^2$ . На зависимости напряжения на интерферометре при  $J > J_c$  от внешнего перпендикулярного поверхности пленки магнитно-

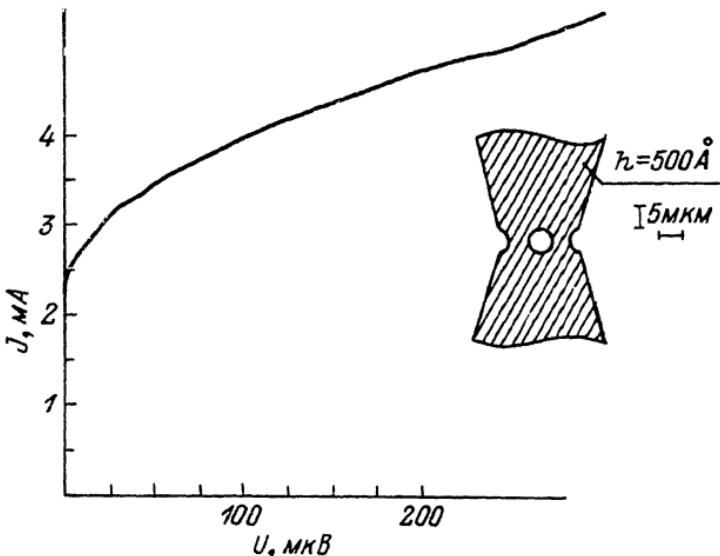


Рис. 1. Конфигурация и ВАХ образца при 77 К.

го поля при 77 К наблюдаются осцилляции с периодом по полю  $\Delta H = 2 \cdot 10^{-1}$  Э (с амплитудой  $\Delta V \approx 3$  мкВ), что соответствует контуру квантования диаметром  $d \approx 10$  мкм. На фоне этих осцилляций наблюдаются также осцилляции с периодом по полю  $\Delta H = 5 \cdot 10^{-2}$  Э ( $d \approx 20$  мкм) и амплитудой  $\Delta V \approx 0.5-1$  мкВ, что показано на рис. 2. Такое поведение в магнитном поле может быть связано со статистическим ансамблем контуров квантования, образованных сверхпроводящими гранулами в пленке, соединенными джозефсоновскими слабыми связями. При использовании в работе схемы измерений на постоянном токе мы получаем информацию о контурах расположенных в той части образца, где наблюдается наибольшая плотность тока, т.е. в районе отверстия. В соответствии с этим, контура квантования, превышающие диаметр отверстия, вероятнее всего, охватывают его. Роль отверстия в данном случае сводится к тому, что оно выделяет из всего набора контуров те, которые превышают его размер.

Аналогичное поведение наблюдалось ранее в массивном односвязном образце [4]. Следует указать на сложный, нерегулярный, но воспроизводимый в интервале нескольких периодов характер осцилляций напряжения. Гистерезис на  $V(H)$  начинает проявляться при заметном (3-4 периода) отходе от начального поля, что можно связать с захватом потока с сложных многосвязных конфигурациях контуров квантования.

Характер зависимости  $V(H)$  меняется при увеличении толщины пленки. Так, для пленок с  $h \gtrsim 1000$  Å интерференция отсутствует, что может свидетельствовать о более сильной связи между гранулами, чем в случае тонких пленок. Таким образом, описанный в статье интерферометр с рабочей температурой 77 К и контуром квантования, охватывающим изготовленное в интерферометре отвер-

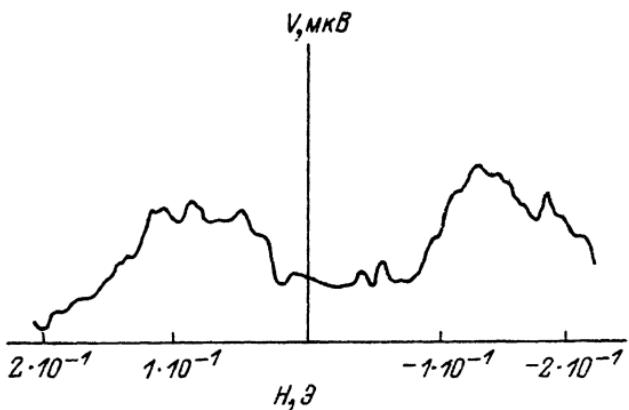


Рис. 2. Зависимость  $V(H)$  образца при 77 К.

стие, основан на использовании тонкой ( $h \leq 500 \text{ \AA}$ ) пленки из ВТСП керамики со случайными слабыми связями между гранулами. В то же время, интерферометры со строго заданным контуром квантования могут быть получены только после создания слабых связей с размерами порядка длины когерентности и их использования в хорошо известных к настоящему времени конфигурациях, отработанных на традиционных сверхпроводниках.

Предполагая возможность разрешения  $10^{-4}$  доли кванта магнитного потока  $\Phi_0$ , что реально для тонкопленочных интерферометров [6], чувствительность описанного в статье интерферометра на основе пленок ВТСП может составить  $10^{-6} \text{ Э}$  при 77 К.

#### Список литературы

- [1] Gough C.E., Coleough M.S., Forgan E.M. et all. // Nature. 1987. V. 326. N 6116. P. 855-856.
- [2] Веркин Б.И., Дмитренко И.М., Дмитриев В.М., Карцовник В.В. и др. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 1. С. 34-38.
- [3] Заваринский Н.В., Заваринский В.Н., Петров С.В. // Письма в ЖТФ. 1987. Т. 46. В. 11. С. 469-471.
- [4] Zimmerman J.E., Beall J.A., Grammer M.W., Ono R.H. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51(8), N 24. P. 617-618.
- [5] Шабло А.А., Лукашенко А.В., Бондаренко С.И., Батрак А.Г. // ФНТ. 1988. Т. 14. № 6.
- [6] Koch R.H., Umbach C.P., Clark G.J., Chandchari P., Laibowitz R.B. // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51(3). P. 200-202.

Поступило в Редакцию  
21 апреля 1989 г.